

面発光レーザー(VCSEL)用 酸化装置

新発売

国内・国外問わず酸化デモ承ります！！

用途

面発光レーザー(VCSEL)量産のためのキープロセスである電流狭窄層作製装置です。
販売から15年以上の実績を誇り、多くのお客様に高評価をいただいているベストセラージェットです。

特長

- ・リアルタイムでリアクタ内の酸化サンプルの観察が可能
- ・優れた酸化性能(面内均一性、再現性)
- ・自動運転(立上げ、立下げ、自動酸化モード)

仕様

- ・基板サイズ 6インチ基板×1枚、4インチ基板×1枚、
3インチ基板×3枚、2インチ基板×7枚
- ・基板加熱機構 抵抗加熱方式(Max600℃)
- ・酸化性能 面内均一性 : 20 μm ±0.2 μm (周辺除く6インチ基板面内)
再現性 : 20 μm ±0.2 μm (run to run)
※但し、AlAsエピ層の性能による

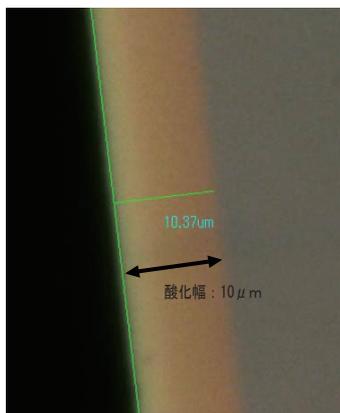


納入実績

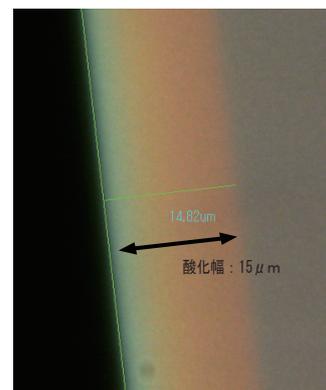
大学 : 東京工業大学 他
民間 : 国内10社

モニター画像

※ 画像は酸化評価用サンプル(光学倍率: 10倍)



酸化温度 : 450℃ 酸化時間 : 10分



酸化温度 : 450℃ 酸化時間 : 15分